

ニュース

半導体洗浄装置用の水撃方式ナノバブル発生装置販売を開始しました

弊社は、10nm以下の酸素ナノカプセルを一気に作る水撃方式（Tachibana Nano Bubble Generator：TNBG）を世界で初めて開発に成功、産業用として本格的に実用段階に入っています。そしてこの度、半導体洗浄装置として販売を開始しました。この装置を使ってオゾンを入れると半導体洗浄に使えます。

製品ラインナップ

		
圧縮空気駆動方式	100V、200V電源駆動	100V電源駆動
半導体洗浄装置	切削のクーラントなど工業用	研究用
接液部は、フッ素樹脂	接液部は、SUSと真鍮で選択可能	接液部は、フッ素樹脂
ナノバブルの大きさ 10nm以下が可能	ナノバブルの大きさは、相談頂き決める。	ナノバブルの大きさ 10nm以下が可能
4L/分以下	10L/分～15L/分	1L/分

実用例

高濃度酸素ナノカプセル水 8K の製造

- 酸素を 10nm 以下の大きさを 1cc 中に 200 京個 (20 億×1 億倍) をカプセル化した水
- 酸素不足が原因で体に起こる諸症状の改善
- 血中酸素濃度が少ない体調不良の人は、飲料することで不足する酸素を補うことが可能